

電子ビーム描画装置、EUV 露光装置、ナノインプリント・リソグラフィー向け

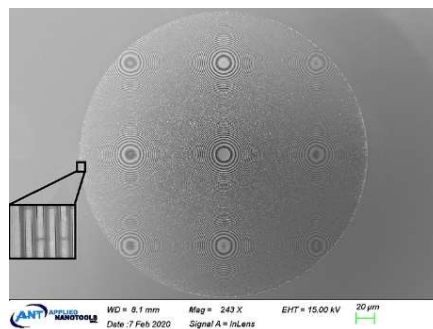
H-SiO_x ネガ型 粉体のレジスト

粉体のレジストならではの特徴：

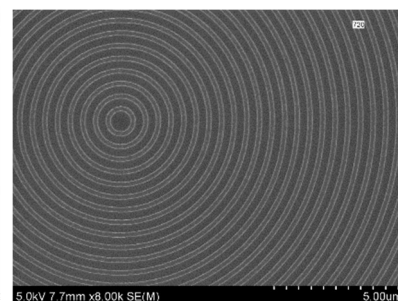
- 長期間の保管が可能です …1年間の保管期間
- いつも同じ粘度で使えます …使用前に溶媒と混合して使うので増粘しません
- 広い範囲の厚さの膜を作れます …粘度を調整することができます
- 5nmの膜厚、7nmの解像度 …最新のテストで達成しました
- 廃棄する量を減らせます …長期保存ができ、少量単位で購入出来ます
- しっかりしたサポート体制 …経験豊富な AQM 社がサポート
- 優れた LER(Line Edge Roughness)
- 強いドライエッチングに対する耐性



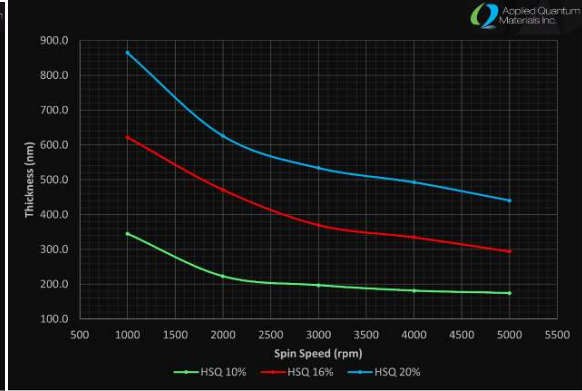
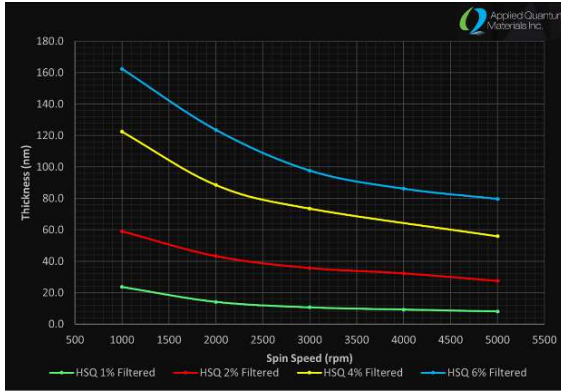
粉体の H-SiO_x



H-SiO_x のパターン画像 1



H-SiO_x のパターン画像 2

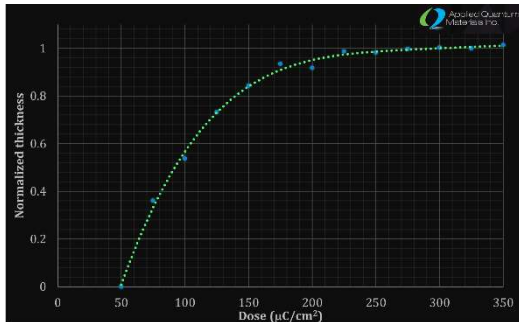


MIBK 溶媒中 1, 2, 4 and 6% H-SiO_x のスピナーカーブ

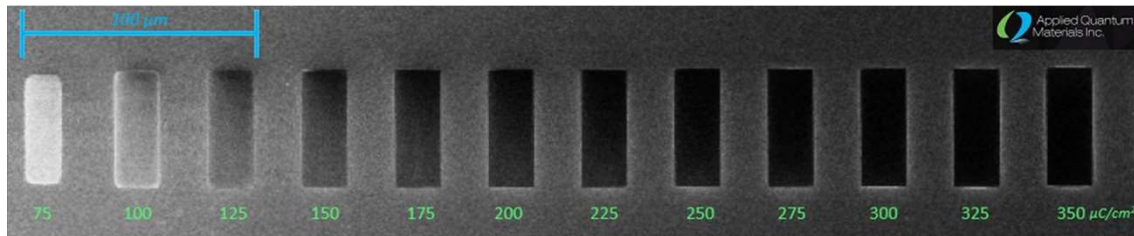
MIBK 溶媒中 10, 16 and 20% H-SiO_x のスピナーカーブ

| H-SiO _x | MIBK | w/w 溶液 |
|--------------------|--------|--------|
| 1.002 g | 5.0mL | 20% |
| 0.256 g | 5.0mL | 6% |
| 1.024 g | 20.0mL | 6% |
| 0.0405 g | 5.0mL | 1% |

各濃度の H-SiO_x と MIBK の重量



90 秒間 MF-319 で現像された 80nm H-SiO_x のコントラストカーブ



各エネルギー量に曝されて現像された 80nm 厚の H-SiO_x の SEM 写真(サイズ 20 x 50um)

Applied Quantum Materials 社 日本総代理店



オプトシリウス株式会社

E-mail: spe@optosirius.co.jp

<http://www.optosirius.co.jp/>

本社: 〒115-0055 東京都北区赤羽西1丁目2番地14号 MYビル TEL.03-5963-6377 FAX.03-5963-6388
 西日本営業所: 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-67 シャリエ新大阪707 TEL.06-7171-7654 FAX.06-7172-5904

● 記載された製品名および社名等は各社の登録商標です。製品の仕様は予告なく変更される場合があります。